

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第1区分
 【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2005-500650(P2005-500650A)

【公表日】平成17年1月6日(2005.1.6)

【年通号数】公開・登録公報2005-001

【出願番号】特願2003-507833(P2003-507833)

【国際特許分類】

H 01 B 1/12 (2006.01)

G 03 F 7/004 (2006.01)

H 01 B 13/00 (2006.01)

【F I】

H 01 B 1/12 Z

G 03 F 7/004 5 2 1

H 01 B 13/00 5 0 3 D

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月7日(2005.6.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

支持体及び露光区別化可能な (light-exposure differentiable) 要素を含んでなる導電性パターンの形成のための材料であって、該露光区別化可能な要素がポリアニオン及び置換もしくは非置換チオフェンのポリマーもしくはコポリマーを含有する伝導率強化最外層ならびに場合により該最外層と隣接する第2層を含んでなり；ここで該最外層及び／又は該場合による第2層は露出されると該最外層の非露出部分に対して該最外層の露出部分の伝導率を低下させることができるモノジアゾニウム塩を含有することを特徴とする材料。

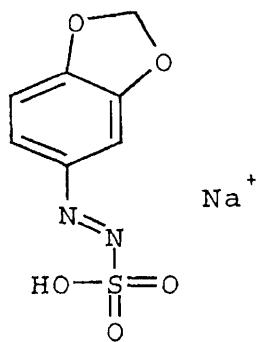
【請求項2】

支持体及び露光区別化可能な要素を含んでなる導電性パターンの形成のための材料であって、該露光区別化可能な要素がポリアニオン及び置換もしくは非置換チオフェンのポリマーもしくはコポリマーを含有する 10^6 / 平方より低い表面抵抗を有する最外層ならびに場合により該最外層と隣接する第2層を含んでなり；ここで該最外層及び／又は該場合による第2層は露出されると該最外層の非露出部分に対して該最外層の露出部分の伝導率を低下させることができるモノジアゾニウム塩を含有することを特徴とする材料。

【請求項3】

該モノジアゾニウム塩が

【化3】



である請求項1又は2に従う材料。

【請求項4】

- 請求項1又は2に従う導電性パターンの形成のための材料を準備し；
 - 材料を画像-通りに露出し、それにより場合により現像液を用いて非-露出領域に対する露出領域の伝導率の低下を得る
- 段階を含んでなる支持体上に導電性パターンを形成する方法。